⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-108424

Olnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)6月13日

C 08 G 65/30 // C 08 G 65/20

8319-4J 8319-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

分子量分布のシャープなポリオキシテトラメチレングリコールを得

る方法

创特 願 昭58-215111 顧 昭58(1983)11月17日 ❷出

②発 明 者 明 砂発 者

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

砂発 明 者 外 村 佐 藤

正一郎 堆

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

発明の名称

分子量分布のシャープなポリオキシテトラメ チレングリコールを得る方法

修許請求の範囲

ポリオキシテトラメチレングリコールとメタ ノール使用量の 1.7倍重量以下またはエタノール使 用量の30倍重量以下の水とをメタノール及び/ま たはエタノールの存在下に接触させ、水量に応じ た高分子量体からの分子量分別批論を行ない、高 分子量部分及び/または低分子量部分を除去する ことにより分子量分布のシャープをポリオキシテ トラメチレングリコールを得る方法

3. 発明の詳細な説明

本発明は、ポリオキシテトラメチレングリコー ル(以下PTMGと略す)の低分子煮部分、または 尚分子量部分、あるいはそれら両部分を除くこと により分子量分布のシャープをPTMGを得る方法 に関するものである。

PTMGはスペンデックスキボリウレタンの主要

- 1 -

順料である有用をポリマーである。 スパンタック スの原料としては数平均分子量が800~300個 度のものが用いられるが、工業的に人手可能な PTMGは一般に広い分子量分布を持つており、オ リゴマーから数万にも進する高分子量体までが含 まれている。一方、スパンデックス物性の上から は、この様を低分子量体及び高分子量体を含まな い、分子量分布のシャープなPTMGを用いること が好ましいと云われている。

分子量分布のシャープなPTMGを得る方法とし 健型勝イオン交換樹脂の存在下、約120~150℃ の温度で、低分子量部分を解重合するととにより 分子量分布のシャープなPTMGを得る方法が示さ れている。しかしとの方法は、イオン交換樹脂の 使用限度近い高温での反応を必要とし、しかも分 子量分布のシャープなものを待るには原料PTMG の15多~40多を解重合してテトラヒドロッラ ンとする必要があり、コスト的な問題がある。さ られこの方法では高分子豊体を除くととは不可能

である。

一般に低分子量体と高分子量体とを共に除くことの可能な方法としては、ポリマーの良器膜と貧器膜を組合わせた分別の機法が知られている。

しかし、PTMGの良溶媒と賃落媒である水とを銀合せた果ではエマルジョン化する問題があり今までに分別沈緑の可能を果は見出されていない。このエマルジョン化の問題を解決する方法として、米劃特許第347B10B号明細書には、PTMGをペンゼン、トルエン等の溶媒に溶かした優に、メタノールー水の個合溶媒を作用させてPTMGの低分子量体を抽出して軟く方法が示されているが、この方法では、低分子量体しか除去しえないという欠点を有する。

本発明者はPTMGK対する種々の良裕群と水、 ヘキサン、アセトニトリル等の貧裕群とを用いた 分別沈澱法について詳しく再検討した。

その結果、一般に分別抗療法では、多量の質溶 体を用いるほど抗験量は多くなるが、 PTMGに対 してメタノールー水又はエタノールー水を用いた

- 3 -

合することにより、尚分子量体の PTMGを固体あるいは 核体で沈降させて二相に相分離して除去し、 上相を脱部継することで高分子豊部分の除かれた PTMGを得る方法。

(b) PTMGをメタノール又はエタノールに移かし、次いで水をメタノール使用量の 1.7倍重量以下 又はエタノール使用量の 3.0倍重量以下の範囲で加 えることにより、あるいは上記重量比に調節した メタノールー水又はエタノールー水混合熔鉄と PTMGを混合することにより、低分子量体のPTMG を除いた部分を固体あるいは液体で沈降させて分 雕回収し、次いで脱溶薬することで、低分子量部 分の除かれた PTMGを得る方法。

上配(a)の方法で二相に相分離させて下相を除いた後、上相客旅に水をメタノール重の 1.7倍重当以下欠はエタノール量の 3.0倍重量以下の範囲内で、更に加えることにより、あるいはメタノール又はエタノールを無質等で除き、水のアルコールに対する真質比を上記範囲まで高めることにより、低分子量 PTM Gのみを解解させて残し、他の部分を

場合には驚くべきことに第1 図にメタノールー水の例で示した機に、一定の水量の所で抗激量は最大になりそれを超える水を加えるとエマルション 化が激しくなりな機量は減少し、分子量による分別は行なえなくなり、それ以下の水量にあいての み分子量による分別が可能であることを見出し、 この知見を基にして本発明を成すに至つた。

すなわち、本発明は、PTMGとメタノール使用 量の1.7倍重量以下またはエタノール使用量の3.0 倍重量以下水とをメタノール及び/またはエタノ ールの存在下に接触させ、水量に応じた高分子量 体からの分子量分別沈緩を行ない、高分子量部分 及び/または低分子量部分を除去することにより 分子量分布のシャープなPTMGを得る方法である。

本発明法は具体的にはたとえば以下の(a) ~ (b) の 方法により実施する。

(a) PTMGをメタノール、又はエタノールに番かし、次いで水を白褐が生する量以上加えることにより、あるいは上記水濃度に調節したメタノールー水災はエタノールー水気台移譲とPTMGを混

- 4 -

関体あるいは液体で抗降させて分解回収し、脱溶 集することで低分子量部分及び高分子量部分の除 かれたPTMGを得る方法。

本発明で使用するPTMGには時に制約はないが、 数平均分子量は分子量分布にもよるが、 800~ 8000程度が好ましい。

PTMG使用量に対する溶解使用量の重量比は
0.5~2 0 が好ましい。 0.5 未満では分子量による
分別がうまく行なわれず、分子量分布はあまりシャープにはならない。 2 0 を越える溶解を用いて
も効果に差はなく新たな利点は生じない。

PTMGのアルコール落液に抵加して白機を生する水量はPTMGの分子量、PTMG機度、温度等によつて変化するが、数平均分子量 1750、機度20 重量が、数度 25℃での値は、メタノールを用いた場合はメタノール量の約0.75倍重量である。

原料 P T M Gから高分子豊体を除く場合には、白稿章を若干上まわる量の水を加えて、沈降した部

- 5 -

分を除くが、水量を多くしすぎると、有用な分子 量部分まで沈降して好ましくない。最適水量は条 件により多少変動するが、白傷を生ずる量から、 その1.4倍量の範囲である。

起度は使用密媒の沸点以下で行なりのが好ましいが、 低分子量体を選択性良く分離するためには 3 0 七以下で行なりのが良い。約 1 5 七以下では、

- 7 -

せる。下相の高分子量体部分を相分離して除く。 上相に H ±O を 2.4.8 kg/m えて充分に提押した後、25 でで 2.0 時間 静徹して相分離させ、下相の P T M G 相を回収する。上相には低分子量部分が海解して いる。分離した各相を脱溶鉄した競果を授一1 に 示す。

授 一 1

| | 重量(Lp) | 教平均分子量 🗹 🛭 | d |
|---------------|--------|------------|------|
| 原料PTMG | 1. 0 | 1750 | 1. 9 |
| 高分子量部分 | 0. 1 3 | 3 2 0 0 | 1. 3 |
| 低分子量部分 | 0.15 | 600 | 1. 8 |
| 精製PTMG | 0. 7 2 | 2000 | 1. 3 |

突流伤 :

PTMG 1.3 kg $(\vec{M}_{*}=1500\ d=1.8)$ をメタノール 31 kg に移かす。次に $H_{2}O$ を 34 kg加え て光分に 機神したのち、 10 でで 30 時間 静徹 して柏分職させる。 低分子量部分の密解した上相と、 下相を分離して、それぞれ脱密旗する。その結果を製ー2 に示す。

PTMGは固体として比較するが、PTMGを多く回収したい場合には低温の方が好ましい。

水恋が後、完全に相分離するまでには数時間~ 数十時間が必要であるが、速心分離を行なりこと で時間を短縮することが可能であり、得られる結果にも有意な差はない。実施形式は、提择装置、 相分雕槽、蒸馏装置あるいは、提择装置、速心分 雕椽、蒸馏装置等を用いたパンチ式、連続式のい ずれも実施可能である。

本発明では分子量分布の尺度として(1)式で示される多分散度(d)を用いる。

$$d = \overline{M} = /\overline{M} = \cdots \cdots (1)$$

ここで、M。は数平均分子量、M→は重量平均分子量であり、これらはゲルバーメイションクロマトグラフィー (GPC)により測定した。

以下、実施例を挙げて本発明を説明する。

疾施例 1

PTMG 1.0 kp (M = 1750 d = 1.9) をメタノール 4.0 kp に密かす。次に H = Oを 1.5 2 kp 弥加して充分に攪拌した後、 2 3 C で 3 時間鬱黴して相分離さ

- 8 -

| | 重量(Ke) | 数平均分子量 | d |
|------------|--------|---------|------|
| 原料 P T M G | 1. 3 | 1 5 0 0 | 1, 9 |
| 低分子量部分 | 0.23 | 5 0 0 | 1. 9 |
| 精製PTMG | 1, 0 7 | 1800 | 1. 5 |

比較例 3

被一 3

| | 重量(K) | 数半均分子量 | . d |
|--------|--------|---------|------|
| 旗料PTMG | 1. 3 | 1500 | 1. B |
| 上相PTMG | 0.67 | 1300 | 2.0 |
| 下相PTMG | 0. 6 3 | 1 9 0 D | 1. 4 |

特開昭60-108424(4)

機件したのち、10℃で3時間靜面して相分離させる。各相を脱俗難してPTMGを回収する。下相より商分子遺俗PTMGが、上相から精製PTMGが得られる。その結果を数一5代示す。

表 - 5

| | 遊戲 (g) | 數平均分子數 | ď |
|---------------|---------------|--------|------|
| 像料PTMG | 100 | 1500 | 1.9 |
| 高分子監部分 | 1 8 | 3050 | 1. 3 |
| 有製PTMG | 8 2 | 1350 | 1, 6 |

4 図頭の簡単な説明

等許出願人 旭化成工業株式会社

宝 蘇 例 3

表一 4

| | At (e) | 数半均分子量 | ď |
|---------|---------------|--------|------|
| IN*PTMG | 4 0 | 1750 | 1. 9 |
| 高分子量部分 | 7. 2 | 2800 | 1. 6 |
| 低分子量部分 | 7. 3 | 5 6 0 | 2.0 |
| 稍製PTMG | 2 5. 5 | 1800 | 1. 4 |

尖腕剉 4

PTMG (Mo=1500, d=1.9) 100g をメタノ ール 500gに帯かす。 H20を 195g 加えて光分に

-11-

- 12 -

第1図

